



ナノインプリント技術の進展と展開

概要

1996年にPrinceton Univ.のS. Y. Chou教授によってナノインプリントリソグラフィが提唱されて以来、ナノインプリント技術は微細パターンを低成本に作製できる技術として注目を集めてきた。日本においては2014年からキヤノンがMolecular Imprint社の技術を取り入れ、次世代半導体デバイス向けのパターニング装置としてプラスチックアップが続いている。また、ナノインプリントプロセスにおけるレジストの充填や剥離挙動など、基礎的な現象の理解も進んでいる。さらに、Roll to Roll プロセスによる連続プロセスは、ディスプレイなど、大面積微細構造作製への応用を可能にしていくであろう。微細構造を安価に提供できるという特徴を生かして、バイオセンサーなどへの応用検討も始まっている。本企画では、学会レベルから実用化に向けて動き出したナノインプリント技術を俯瞰し、今後の展開を議論する。

日時
(予定)

**2017年3月15日(水)
13:00～17:45(予定)**

招待
講演者
(予定)

廣島洋	産業技術総合研究所
ナノインプリント技術の進展	
伊藤俊樹	キヤノン
半導体製造用ナノインプリントシステム	
阿部誠之	旭化成
Roll to Roll ナノインプリントによるデバイス作製	

